

证券代码：688729

公司简称：屹唐股份

北京屹唐半导体科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	业绩说明会
活动主题	屹唐股份 2025 年度暨 2026 年第一季度业绩说明会
时间	2026-05-15 - 13:00-14:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长：张文冬、董事、总裁兼首席执行官：陆郝安、独立董事：王汇联、独立董事：戈峻、独立董事：金雨青、副总裁兼财务总监：谢妹、董事会秘书：单一
投资者关系活动主要内容介绍	<p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容</p> <p>1、150*****202 问屹唐股份董事、总裁兼首席执行官陆郝安：快速热处理、干法刻蚀业务增速亮眼，后续是否会加大研发投入，拓展更多前道设备品类实现平台化发展？</p> <p>董事、总裁兼首席执行官陆郝安答：尊敬的投资者，您好！公司通过持续研发投入，对现有干法去胶、快速热处理、干法刻蚀及等离子体表面处理设备持续开展技术改进升级，不断提升产品的竞争力，保持产品先进性。面向国内外新老客户对高端集成电路设备的多样化需求，成功研发多款技术领先的新型集成电路设备。</p> <p>快速热处理设备方面，公司借助在高温快速热处理、等离子体源及超高产出设备平台等领域的技术积累，已开展新的研发工作，包括开发新一代常压快速热处理设备、先进低压快速热处理设备、新型快速热处理设备（包括具备低热预算且具有选择性加热的新一</p>

代快速热处理设备以及集成多项连续工艺流程的快速热处理一体化设备)。报告期内,部分项目已完成产品开发,处于客户进行量产验证过程中。

干法刻蚀及等离子体表面处理设备方面,公司开发推出了新一代先进干法刻蚀设备 RENA-E®,该设备已通过关键客户量产验证并获得客户重复量产订单,且已导入多家客户进行量产验证,客户需求在持续增长。

公司开发的先进等离子体表面处理和材料改性设备 Escala®利用专利技术产生高浓度化学反应自由基,在低热预算下有效改善各种薄膜材料的性质和性能,广泛应用于存储器和逻辑半导体制造中金属薄膜电阻率降低,裂缝修复,增强钨薄膜选择性沉积,增强可流动化学气相沉积介质薄膜致密度等。该设备已通过多家关键客户技术验证并实现重复量产订单,客户需求在持续增长,公司将持续推进该设备在更多客户进行量产验证。

除了上述已量产的新产品之外,为了更好地满足国内外客户对于干法刻蚀及等离子体表面处理设备的广泛需求,进一步提升公司在干法刻蚀及等离子体表面处理设备领域的可服务市场规模,公司目前已开展多项新型干法刻蚀及等离子体表面处理设备研发项目,部分项目已完成产品研发,即将开展客户端验证。

公司近年来持续加大快速热处理、干法刻蚀和表面处理设备的研发投入和客户导入力度,并取得了良好效果。未来公司将继续加大研发投入,持续开发有市场竞争力的新产品,并积极向更多客户导入新产品,扩大可服务市场规模,实现平台化发展。

2、150*****202 问屹唐股份董事长张文冬：受海外实体清单及地缘政策影响，公司海外供应链、出口业务有哪些应对方案，国内替代供应链是否已完全稳定？

董事长张文冬答：尊敬的投资者，您好！为应对全球半导体供应链波动与地缘政治风险，公司建立了系统、科学的供应链评估与管理体系统。不仅覆盖资质、产能、技术、质量、价格、交期、服务等基础要素，更强化了对关键零部件国产化能力及供应链抗风险指标的量化评估。公司已与全球众多供应商建立了长期稳定的合作关系，确保合格供应商的长期稳定性。同时从需求预测、库存管理、供应商管理三方面进行动态协调，以确保供应稳定的前提下做到成本最优。中国制造基地近年积极推行供应链多元化与本地化战略，有效提高了设备零部件国产化率，缩短物流周期并降低采购成本，做到了供应链整体安全、可控。

3、150*****202 问屹唐股份董事长张文冬：公司干法刻蚀设备目前客户认证及批量导入进展如何，未来 1-2 年放量节奏与目标市占率规划？

董事长张文冬答：尊敬的投资者，您好！2025 年，公司开发推出了新一代先进干法刻蚀设备 RENA-E[®]，该等离子体刻蚀机可以对离子能量和离子密度进行独立控制，具备刻蚀速度快、晶圆器件等离子体损伤小、器件性能表现优异、反应腔损耗品寿命长等各项卓越性能，还可以高效应对介质材料和金属材料的复杂膜层刻蚀。该设备已通过关键客户量产验证并获得客户重复量产订单，且已导入多家客户进行量产验证，客户需求在持续增长。

公司开发的先进等离子体表面处理和材料改性设备 Escala[®]利用专利技术产生高浓度化学反应自由基，在低热预算下有效改善各种薄膜材料的性质和性能，广泛应用于存储器和逻辑半导体制造中

	<p>金属薄膜电阻率降低，裂缝修复，增强钨薄膜选择性沉积，增强可流动化学气相沉积介质薄膜致密度等。该设备已通过多家关键客户技术验证并实现重复量产订单，客户需求在持续增长，公司将持续推进该设备在更多客户进行量产验证。</p> <p>除了上述已量产的新产品之外，为了更好地满足国内外客户对于干法刻蚀及等离子体表面处理设备的广泛需求，进一步提升公司在干法刻蚀及等离子体表面处理设备领域的可服务市场规模，公司目前已开展多项新型干法刻蚀及等离子体表面处理设备研发项目，部分项目已完成产品研发，即将开展客户端验证。</p>
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------